

オゾン水製造装置

KHOW[®] SYSTEM OS型



ウェットプロセスに革命！ 環境負荷の少ない洗浄を実現！！
抜群の有機物除去効果・表面酸化効果

特 長

- ・高い溶解効率を実現
溶解膜を採用することで、効率的にオゾンガスを溶解できます。また、微量の炭酸ガスを溶解させることで、溶存オゾン濃度維持が可能です。
- ・濃度追従機能による安定供給
溶存オゾンガス濃度を測定しオゾンガス発生量を制御させたことで、安定した溶存オゾン濃度のオゾン水が供給可能です。
- ・薬品使用量の大幅削減で環境負荷を低減
薬品洗浄の代替として使用できるので、環境負荷を低減します。また、排水負荷が低減するので、排水コストを削減できます。
- ・ボタンひとつで全自動運転
装置の運転状態はタッチパネルに集中表示されるので、運転管理が容易です。

用 途

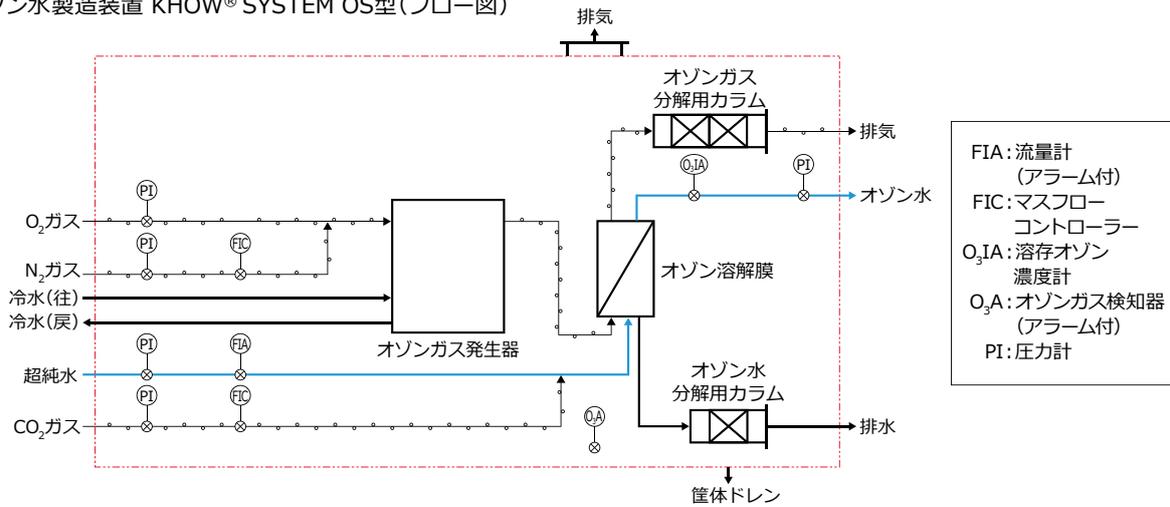
半導体・ウェハ／酸化膜形成
ディスプレイ(液晶・有機EL)／有機物除去洗浄、基板表面改質・濡れ性向上
フォトマスク・ハードディスク／基板表面改質・濡れ性向上

※QRコードからKCRセンターのホームページに掲載している製品情報ページをご覧ください。



フロー図

オゾン水製造装置 KHOW® SYSTEM OS型(フロー図)



仕様表

| 型式 | OS-10 | OS-20 |
|---------------|---|-------|
| オゾン水流量[L/min] | 10 | 20 |
| 主な給水条件 | 超純水 | |
| 溶存オゾン濃度[mg/L] | ~20 | |
| 一次電源 | AC100V × 1φ×50/60Hz AC200V /220V × 3φ ×50/60Hz | |
| 電源容量[kVA] | 1 3 | |
| 外形寸法[mm] | 幅 | 700 |
| | 奥行 | 850 |
| | 高さ | 1850 |
| 製品重量[kg] | 300 | 300 |
| 運転重量[kg] | 400 | 400 |

屋内仕様になります。

両用機(水素水+オゾン水)、セントラル方式(大型装置、工場一括供給)のご相談は、別途お問い合わせください。

窒素水(パターン倒壊抑制)、炭酸水(基板帯電防止)のご相談は、別途お問い合わせください。

本カタログで使用している商標(製品名・サービスおよびロゴ)は、当社が使用を認めた権利者に帰属しますので、無断で使用することはできません。

改良のため、予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

警告 据付、取付、取外し、保守等については取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。

2018年4月1日現在

 **栗田工業株式会社**
Kurita

〒164-0001
東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト
<http://www.kurita.co.jp>

水処理のご相談は「KCRセンター」まで

 **0120-40-7474**

<http://kcr.kurita.co.jp/>